



2025 年 1 月 14 日

各 位

新型濺鍍靶材「WL-TCO™」的量產及銷售

本公司(社長:納 武士)特此公告,薄膜材料事業部中作為透明導電膜用途,並可有效減少 Particle 及蝕刻殘留的濺鍍※¹靶材「WL-TCO™」,將正式開始量產銷售。

作為電視、智慧型手機、車載顯示器等各種應用的平面顯示器電極材料,高導電性、高透明度的透明導電薄膜是不可或缺的。因此可對應大面積均勻成膜的 ITO※²濺鍍靶材廣泛地被採用。

為了形成 ITO 透明電極・配線,必須在設備通入水氣的狀態下進行濺鍍,以確保後段配線加工(蝕刻)不會有殘渣問題。然而水氣的導入會使濺鍍過程中容易產生稱為 Particle 的不良顆粒,因 Particle 造成的不良增加、導致良率下降,這是 ITO 靶材所面臨的挑戰及課題。

此次,本公司推出了新透明導電膜材料「WL-TCO™」,可在不通水氣的情況下進行濺鍍,並形成具有與 ITO 相同導電性及透明度的透明導電薄膜,使用 WL-TCO™能有效抑制 Particle 的生成,進而提高平面顯示器的良率並實現低成本。近日此靶材已在薄膜材料事業部的主力工廠—台灣特格股份有限公司(台中市,台灣)開始量產製造,並向大型平面顯示器製造商進行銷售。WL-TCO™所帶來的 Particle 及蝕刻殘留改善效果,將有助於顧客的節能・產品良率提升,並減輕環境負荷。

本公司以「秉持探索精神,融匯多樣技術,讓地球綻放笑容」為核心使命,致力於實現 2030 年公司願景「活用材料智慧,打造貢獻未來的創新企業」。為構建可持續的社會作出貢獻。

以 上

【聯繫方式】

三井金屬 經營企劃本部 企業傳播部

TEL : 03-5437-8028 E-mail : PR@mitsui-kinzoku.com

【參考】



圖 1 . WL-TCO™ 靶材照片

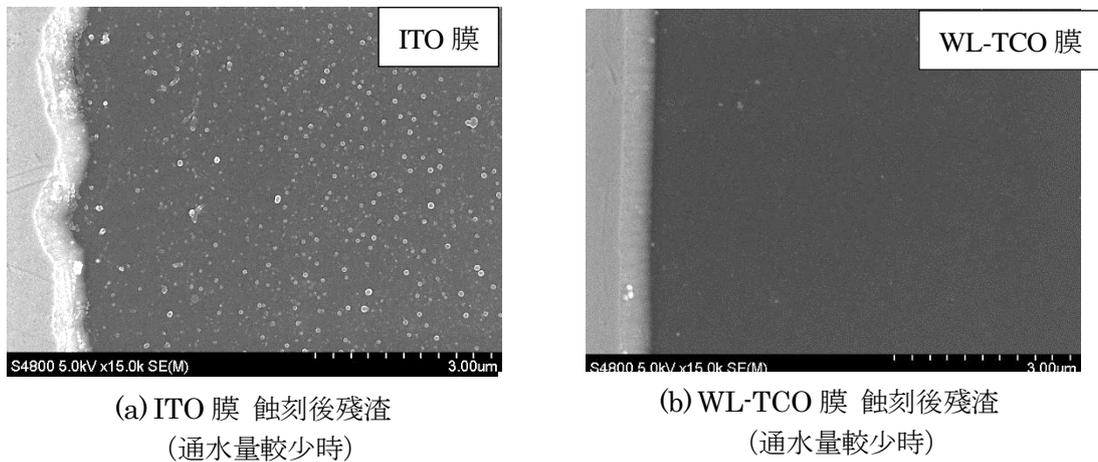


圖 2 . 濺鍍薄膜蝕刻後的殘渣照片

【專業用語說明】

※1 在真空環境中以氬 (Ar) 離子加速撞擊靶材，靶材中被轟擊出的原子沉積於反方向的基板上，進而形成薄膜的方法。

※2 Indium Tin Oxide 的簡稱